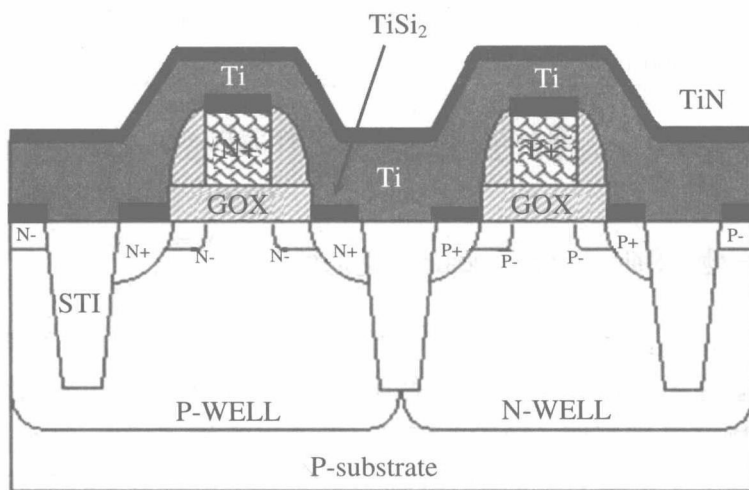


圖 6-28 Ti 與 TiN 沉積。

圖 6-29 TiSi₂ 之形成。

(3)將 TiN 與多餘的 Ti 移除，再進行第二次快速熱處理（2nd RTP），使 TiSi₂ 的阻值降得更低，最後再清洗晶圓以完成 Silicide 的步驟，如圖 6-30 所示。